

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成18年11月2日(2006.11.2)

【公開番号】特開2001-152335(P2001-152335A)

【公開日】平成13年6月5日(2001.6.5)

【出願番号】特願平11-332242

【国際特許分類】

C 23 C 14/50 (2006.01)

H 01 L 21/203 (2006.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

H 01 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/50 A

C 23 C 14/50 E

H 01 L 21/203 S

H 01 L 21/205

H 01 L 21/302 101Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年9月14日(2006.9.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0041

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0041】

その後、真空処理槽2内に例えばアルゴンガス等のスパッタリングガスを導入し、直流電源4を起動してターゲット3に負電圧を印加すると、真空処理槽2内にプラズマが生成され、ターゲット3の表面においてスパッタリングが行われる。